

机械剥离氧化硅硅基底二硒化钨

中文名称：机械剥离氧化硅硅基底二硒化钨

英文名称：Mechanical exfoliation WSe₂ on SiO₂/Si

货号：ML1116

CAS号：7440-33-7

包装：1片

保质期：6月常温干燥避光

性质

形态：薄膜

参数

基底：氧化硅/硅

基底尺寸： 10 mmx10 mm

氧化层： 300nm

WSe2 面积： $>10 \mu\text{m}^2$

应用： 酶联生物最新推出机械剥离制备的二硒化钨，该类材料具有缺陷少，优异的光学性质，可以研究层数和荧光效应，此外，由于保持了原有晶格结构，所以该类材料是制备器件的理想材料。